計算機合成ディスプレイホログラム用高解像度プリンタ

High-Resolution Printer for Fabricating Computer-Generated Display Holograms

正会員松島恭治⁺, 上甲 篤⁺*

Kyoji Matsushima[†] and Atsushi Joko^{†*}

Abstract A special-purpose high-resolution printer has been constructed for fabricating computer-generated holograms. This printer is capable of drawing fringe patterns exceeding 10^4 dpi in resolution. The patterns are numerically synthesized and have a continuous gray level. The print time is less than an hour for holograms measuring 1 cm^2 . The mechanism and structure of the constructed printer and optically reconstructed images of holograms fabricated by using the printer are described.

キーワード:ホログラム,3次元立体画像,計算機合成ホログラム,ディジタル合成ホログラム,CGH,描画装置

1. ま え が き

一般的な立体画像が,生理的立体感の一部のみを満たす のに対して,ホログラムは人間の生理的立体感をすべて満 たした完全な3次元画像である.しかしながらホログラ ム記録時には,物体にレーザ光を照射して散乱した光波 と,参照光波を感光材料上で干渉させる必要があるため, 実在の物体が必要である.これに対して,近年発展の著し いコンピュータ技術を援用したホログラムを,ディジタル ホログラムと総称し,この中でも,実在しない物体の光 波をコンピュータによって合成し,表示または印刷するホ ログラムを計算機合成ホログラム (Computer-Generated Hologram,以下 CGH),あるいはディジタル合成ホログ ラムと呼ぶ.

CGH は,作成時に被写体を必要としないという利点が ある反面,物体光波合成の計算量が莫大であること,さら に高解像度の表示デバイスを必要とすることが大きな問題 点となっている.前者については,テーブル参照法¹⁾,差 分法²⁾³⁾,漸化式⁴⁾,波面展開法⁵⁾⁶⁾などのアルゴリズム により高速化が進んでいるものの,後者は依然大きな問題 である.計算機合成ホログラムの静止画描画には,レーザ プリンタ⁷⁾やイメージセッタ⁸⁾,あるいはそれらの出力の 写真縮小⁹⁾が用いられるが,いずれも解像度が不充分で

ある.ホログラムの干渉縞の間隔はおよそ1µm以下(解 像度 25,000dpi 以上に相当) であり,これに対し製版用高 解像度印刷機器であるイメージセッタでも,その解像度は 4000dpi 程度である.ホログラムの回折角は,ほぼその解 像度に比例するため,これらの方法では大きな視域角は得 られない.また,本来のホログラムの干渉縞パターンの濃 度(再生時の透過率)が連続値であるのに対して,これら の機器は,本質的に2値の濃度階調でしか描画できないた め,バイナリーホログラムとするか,擬似階調を用いる必 要がある.前者は量子化ノイズの要因となり,また後者は 一般に実効的な解像度の低下を招く.電子線描画や光リソ グラフィの技術を用いれば,波長以下の分解能で描画する ことが可能であるが¹⁰⁾,一般にこれらの設備は極めて高価 でその利用には専門技術が必要であり,また製作時間も数 日から数ヶ月と長いものとなる.そのため,回折光学素子 など数平方ミリ程度の非ディスプレイ用途の CGH 作製に 用いることはできても、一般にディスプレイ用ホログラム の作製には適さないことが多い.

そこで本論文では,解像度 10⁴dpi 以上でマルチレベル の濃度階調付ピクセルが描画でき,1cm² あたり 1 時間以 下の描画時間で写真縮小の過程なしに直接 CGH を描画で きるプリンタの試作結果を報告する.また,本プリンタで 描画した CGH の光学再生像を示す.

2. 原理と構造

試作したプリンタの構造を図1に示す.本プリンタで は,振幅変調したパルス信号で駆動するレーザダイオード (以下LD)の出力光を,対物レンズでホログラム乾板上に 回折限界近くまで集光することにより,乾板上に濃淡像を

平成 13 年関西連大,2002 年電子情報通信学会総合大会で発表 2002 年 4 月 8 日受付,2002 年 7 月 29 日再受付,2002 年 9 月 6 日採録 †関西大学工学部電気工学科

^{(〒 564-8680} 大阪府吹田市山手町 3-3-35, TEL 06-6368-0933) * 現在,松下電器産業(株)勤務

[†] Department of Electrical Engineering, Kansai University (Yamate-cho 3-3-35, Suita, Osaka 564-8680, Japan)

^{*} Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.



図 1 試作プリンタの構造 Schematic structure of the constructed printer.

描画している.試作プリンタで用いたレーザダイオードモジュールは出力のアナログ変調が可能であり,LDドライバに入力する制御電圧に対して,その出力パワーが最大4mWまで線形に変化する.またこの時,定格の最大変調周波数は500kHzであり,実際のパルス入力に対する立上り/立下り時間は約0.2μsである.

ホログラム乾板の適正露光量は,ロシア製 PFG03C で はおよそ $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-4} \mu J/\mu m^2$,アグファ8E75 で はおよそ $5.0 \times 10^{-7} \mu J/\mu m^2$ と言われている.しかしなが ら,LDの定格出力をマイクロメートル程度のスポットサイ ズまで集光した場合,光強度が約 $1mW/\mu m^2$ に達するた め,レーザパルス幅を数マイクロ秒としても,レーザ出力 を $-20 \sim -40 dB$ 程度減衰する必要がある.LD モジュー ル自身による出力制御では,LD の閾値以下でインコヒー レントな LED モードに移行するため,微小出力で使用す ることは困難である.したがって本プリンタでは,LD 出 力の波面を乱すことなく,このような大きな減衰量を得る ため,次節で述べるように,表面コートのないガラスプリ ズムの表面反射を利用してレーザ光の減光を行っている.

2.1 レーザ光学系

具体的には,波長 635nm,定格出力 4mW の直線偏光 LD モジュールの出力光を, p 偏光で屈折率 1.52 の BK7 ガ ラス製直角プリズムに入射角 θ で入射させ,その表面反射 光を用いている.この場合,ブルースタ角が 56.6 度である ため, $\theta \simeq 60^{\circ}$ の時 -30dB 程度の強度減衰率が得られる. 減光したレーザ光を 20 倍の対物レンズ (定格 N.A. = 0.4) により乾板表面上に集光している.また,用いた LD モ ジュールの出力光の横モードが 5.6×1.5 mm²($1/e^2$)の楕 円パターンであることから,その長径軸がホログラムの水 平方向と一致するように対物レンズに入射させ,水平方向 でのスポット径を減少して,光学再生時の水平方向の視域 が垂直方向のそれよりも広がるように工夫している.

2.2 ステージとレーザパルスの制御

ホログラム乾板は,精密 X-Y ステージ上に積載している.試作プリンタでは,X-Y ステージとしてシグマ光機

製自動ステージ (AES-120X(IS)-100) を用いた.このス テージでは, 内蔵する光学リニアスケールにより, 分解能 0.1µm でエンコーダ信号が得られる.通常,このエンコー ダ信号はステージ位置・速度のサーボ制御等を行うために 用いられ、そのようなクローズドループ制御下でのステー ジ移動速度の最大定格値は 4mm/s である.しかしながら, 本プリンタでは,ステージの位置決めそのものは重要では ないため,クローズドループ制御を行っていない.すなわ ち,本プリンタのステージは,再生時に水平方向になる1 ラインの描画中は,オープンループ制御のパルスモータに より停止することなく移動し続けている.その代わりに, エンコーダ信号に基づいてレーザパルス照射タイミングを 制御することにより,結果としてエンコーダの精度と等し い位置精度を確保している.その結果,用いたステージコ ントローラの最大駆動周波数 2.4×10⁵ pulse/s で, 駆動パ ルスあたりの移動量を $0.1 \mu m/pulse$ に設定してステージ を駆動し,24mm/sの最大ステージ移動速度を得ている.

また,レーザパルス幅は約2µsであるので,ステージが 最大速度で運動しているときの1パルス照射中の移動量 は4.8×10⁻²µmとなり,数ミクロン径の描画ドットでは数 %程度の誤差となる.しかし,本プリンタのように高N.A. で集光している場合,運動中のステージ自体の垂直方向位 置の変動や,ホログラム乾板のガラス基板の厚さと感光剤 の膜厚のむらなどにより,集光スポットサイズのその程度 の変動は定常的に生じるため,移動による描画ドットの変 形は無視できる.

本プリンタの制御系のブロック図を図2に示す.エン コーダ信号は,制御コンピュータのISAバス上のエンコー ダカウンタに入力される一方,一組のプログラマブルカウ ンタを介してLD駆動パルスをトリガする.これにより, コンピュータのソフトウェア制御を介さずにレーザ照射タ イミングが得られるため,ステージの最大移動速度と等し い描画線速度を実現している.



図 2 プリンタの制御回路

A block diagram of control circuits for the constructed printer.

また,D/A コンバータの出力電圧を単パルス発生器と C-MOS アナログスイッチでスイッチングすることにより, 一定パルス幅で波高値が PC により制御された LD 駆動パ ルスを発生し,LD ドライバの制御電圧として入力してい る.前述のとおり,本プリンタで使用している LD ドライ バでは,LD 出力波形が制御電圧波形に比例してアナログ 変調されるため,LD は制御電圧パルスと同じ幅で波高値 に比例したパワーのレーザパルスを発生する.

2.3 レーザ照射タイミングの制御

サブミクロンの精度で水平方向のドット位置を制御しつ つある程度高速な描画を実現するためには,レーザパルス 照射タイミングの制御に工夫を要する.

図3に内蔵光学リニアスケールがエンコーダ信号パル スを発生する位置とレーザ照射位置,描画禁止領域の関係 を示す.ステージはパルスモータで駆動され,0.1µmの分 解能で移動指令を受け入れるが,パルスモータのオープン ループ制御だけでは実際にその精度での位置決めは期待で きず,1ラインを走査する度に走査開始点と終了点が変動 する.そこで,エンコーダ信号に基づいて次のようにLD 駆動パルスをトリガしている.

ステージが X 軸 (再生時の水平方向)の正方向に移動を 始めると, $\delta=0.1[\mu m]$ 移動する毎に内蔵光学リニアスケー ル (エンコーダ) が up パルスを出力する.タイミング制御 回路では,この up パルスをまずプログラマブルな n_1 進 カウンタに入力し,このカウンタがカウントアップするま で, $d_1 = \delta \times n_1$ の区間は LD 駆動パルスのトリガを抑制 し,図3に示すパルス照射禁止区間とする. n_1 進カウンタ がカウントアップすると,up パルスは別のプログラマブル カウンタで n_2 分周され, $d_2 = \delta \times n_2$ 間隔で LD 駆動パル



図 3 レーザ照射位置と禁止領域の模式図.○印はエンコーダ 信号パルスが得られる位置,●印はレーザ照射位置を表 す.この図は,最初のup方向走査がn1 = 9,n2 = 3 で行われた場合を表している.

Schematic diagram of laser-irradiated spots and forbidden areas. Open circles (\circ) and solid circles (\bullet) show positions in generating encoder pulses and laser irradiated spots, respectively. This diagram is drawn in a case that the first up-ward scan is making in $n_1 = 9$ and $n_2 = 3$.

スをトリガし,レーザが照射される.

設定したパルス数を照射し終えた後,ステージはさらに しばらく進み,移動指令で指定された位置付近で停止する が,その停止位置をクローズドループ制御していないため, 停止位置には数ミクロン程度の誤差が生じる.この停止位 置の誤差量は,別途up/downパルスをカウントしている エンコーダカウンタにより検出できるので,down方向に 描画する際には,down方向の照射禁止区間を決定するカ ウンターにこの誤差量を補償する値を設定する.これによ り,走査開始点と終了点が変動しても,常に一定の描画領 域にサブミクロンの位置精度でドットを描画している.

3. 描画像とバイナリーホログラムの光学再生像

図 4 に X 方向に 5μ m 間隔で描画したドット列の顕微 鏡写真を示す.この結果からドットサイズが X 方向で約 2μ m, Y 方向で約 4μ m であることがわかる.図 5(a) に示 した 8bit グレイスケールのテスト画像 (240×200 ピクセ ル)を,試作プリンタを用いて横 2μ m,縦 4μ m のドット 間隔で描画した画像の顕微鏡写真を図 5(b) に示す.この 画像は, PFG03C 乾板にレーザ駆動パルス幅 2.1μ s で描い たものであり,描画像の実サイズは $0.48 \times 0.8 \text{mm}^2$ であ る.同様に,図 6(a)の原画像 (512×256 ピクセル)を同じ 条件とドット間隔で描画した結果を (b) に示す.描画像の 実サイズは $1.024 \times 1.024 \text{mm}^2$ である.これらの結果によ り,濃度階調を有する画像を設定したドット間隔で描画で きることが確認できた.

次に,試作プリンタを用いて同じ乾板上にバイナリー ホログラムの描画を試みた.作製したホログラムのパラ メータを表1に示す.このホログラムは,波長 633nmの He-Neレーザによる光学再生用に,横幅14mmのワイアフ レーム物体をホログラムの背面200mmに配置し,漸化式

5µm

図 4 描画ドット列の顕微鏡写真. A photomicrograph of printed dots.



図 5 テスト画像の描画結果 . (a) 原画像 , (b) 描画像の顕微 鏡写真 .

A printed test pattern: original image (a) and its printed image through a microscope (b).



図 6 自然画像の描画結果 . (a) 原画像 , (b) 描画像の顕微鏡 写真 .

A printed portrait: original photograph (a) and its printed image through a microscope (b).

表 1 作製した CGH の主要なパラメータ Parameters used for fabricating holograms.

Number of pixels	8192×4096	
Dot size	2×4	$\mu \mathrm{m}^2$
Reconstruction wavelength	633	nm
Actual width of object	14	$\mathbf{m}\mathbf{m}$
Incident angle of reference wave	3	deg



図 7 バイナリーホログラムの光学再生像.(a)六角柱,(b)立 方体,(c)球.(d)イメージセッタで作製したバイナリー ホログラムの再生像.

Optically reconstructed images of a binary hologram printed by the constructed printer for a hexagonal prism (a), a cube (b) and a sphere (c); reconstructed images of a binary hologram printed by an image-setter (d).

を用いた点光源モデル光線追跡法⁴⁾ により合成した物体光 波をバイナリーホログラムとして描画したものである.ホ ログラムのサイズは $16.4 \times 16.4 \text{mm}^2$ で,ドット間隔から 計算される視域角は水平 18.2度,垂直 9.1度である.六角 柱,立方体,球のホログラムの再生像を図 7(a),(b),(c) にそれぞれ示した.また,比較のために 4064dpiのイメー ジセッタを用いて,(b)と同じ立方体に対して作製したバ イナリーホログラムの光学再生像を(d)に示す.(d)のホ ログラムでは,ドット間隔が縦横とも $6.25 \mu \text{m}$ で最大回折 角がわずか 2.9度であるため,インライン型のホログラム しか作製できず,再生像の中心に非回折光の明るいピーク が生じている.この非回折光は,観察者の眼に直接入射す るため,再生像の観察を妨げるのみならず危険でもある.



図 8 透過率測定用テストチャート.(a)元画像,(b) 描画像. A test chart to measure transmittance of the printed dots: an original image (a) and its printed image (b).

それに対して,同じ立方体を本プリンタで作製したホログ ラムの再生像(b)や,再生像(a),(c)では,回折角が大き く,再生光入射角度を大きく取れるため,非回折光の問題 を大きく軽減できる.

 LD 出力の制御とマルチレベルホログラムの光 学再生像

試作プリンタでは,バイナリーホログラムは比較的容易 に描画できたが,本来の目的であるマルチレベルホログラ ムの再生像は非常に暗く,その視認は簡単ではなかった. これは,図5や図6のように濃淡を有する画像を描画でき ても,再生光に対するその透過率が計算どおり制御できな いと完全なホログラムにならないためであると考えられる. そのため,図8(a)に示した9段階の濃度テストチャート を作成した.このテストチャートの描画像(b)では,それ ぞれの濃度領域が一辺5mmの正方形になるように描画し ており,その描画パターンのそれぞれの濃度領域にHe-Ne レーザを実際に透過することにより,He-Neレーザに対す る透過率を測定した.LDに印加する制御電圧と透過率の 関係をPFG03C 乾板で測定した結果の一例を図9に示す.

この図からわかるとおり,レーザ制御電圧と描画ピクセ ル濃度の関係が線形でなく,レーザ出力が高い時には濃度 が飽和する傾向にあることがわかった.一般にホログラム の記録・再生の理論では,記録時の干渉縞強度と再生時の 透過率分布が線形であることを仮定しており,干渉縞パ ターンを数値的に合成する CGH でも,それを前提条件と して計算している.しかしながら,本プリンタでの描画は そのような線形な領域で行われておらず,描画ピクセル濃 度が高濃度(低透過率)側にシフトしていることが,描画し たマルチレベルホログラム再生像を劣化させている原因と 考えた.

また,このような測定を繰り返すことにより,透過率の 絶対値は現像液の状態や温度などによって多少変化するが, 曲線の概形そのものに大きな変化はないことがわかった. そこで,この曲線を3次スプラインで補間し,数値合成し たホログラムの濃度階調に対して透過率が線形になるよう に電圧制御した.この制御の結果,図10に示すとおり,合 成したホログラムの濃度階調に対して線形に近い透過率分 布を描画することが可能となった.

以上のような制御により, 描画したマルチレベルホ ログラムの再生像を図 11 に示す. 物体は, 点光源密度



図 9 LD 制御電圧と透過率の関係 Intensity transmittance vs. control voltage of LD



図 10 透過率曲線に基づいて LD 出力制御をした時の濃度階 調と相対的透過率.

Relative transmittance vs. gray level of numerically synthesized hologram in LD power control.



図 11 点光源の振幅変調により陰影付けした表面モデル立方 体に対するマルチレベルホログラムの光学再生像 An optically reconstructed image of a multi-level hologram synthesized with shading by using amplitude modulation of point sources.

2.5×10³cm⁻²の点光源モデル光線追跡法で合成した表面 モデルの立方体である.これは,透過率を線形化せずにマ ルチレベルで描画した時には,再生像が暗く視認が困難で あったホログラムの1つであるが,透過率を線形化するこ とにより,明瞭な再生像が得られるようになった.またこ のホログラムでは,面ごとに点光源振幅を変化するだけで, 陰影付けができている.バイナリーホログラムでは,一般 に点光源振幅による面の輝度の制御は困難であり,陰影付 けを行うためには,マスク処理などの追加処理が必要であ るが¹¹⁾,このホログラムでは,数値合成時の点光源振幅を 変化するだけで,観測方向によって変化する平面の輝度補 正¹¹⁾と陰影付けを実現している.

5. 議 論

本プリンタでのホログラム描画試験では,アグファ8E75 やロシア製 PFG03C を主に用いていた.アグファが現在 入手困難となった結果, PFG03Cを主力として使用しつつ ある.一方,実験結果よりレーザビームは約 $2\mu m \times 4\mu m$ のスポットに集光していることがわかった.このスポット サイズとパルス幅 2.1µs, さらにプリズムによる減衰量か ら計算されるエネルギー密度は , $1.3 \times 10^{-6} \mu J/\mu m^2$ であ る.これは、PFG03Cの適正露光量をかなり下回る値であ る.しかしながら,図9からわかるとおり,透過率曲線は 飽和する傾向にある.この理由の1つとしては,レーザス ポットの集光面積内で,光強度が均等に分布していると仮 定していることである.実際には,ビームウェストではガ ウス型の強度分布であり,スポット中心部での光強度は数 倍高い.また,上記の最適露光量のカタログ値はアナログ ホログラムを撮影した場合に,高い回折効率が得られる露 光量であり、ビーム集光時の最適値とは必ずしも一致しな い可能性も高い.さらに,このような特殊な露光条件に対 して,温度や時間などの現像・定着条件が不適切であるこ とも考えられる.

6. ま と め

ディスプレイ用の計算機合成ホログラムを作製するため の高解像度プリンタを試作した.このプリンタは,ガラス プリズムの表面反射を利用して減衰したレーザダイオード の出力を対物レンズによりホログラム乾板上に集光するこ とにより,ドットサイズ2×4µm²以下のドット列を描画す ることができる.また,ホログラム乾板を動かすステージ に内蔵されている,光学リニアスケールからの信号に基づ いてレーザ照射タイミングを制御することにより,描画時 の最大線速度24mm/sを実現している.これにより,1cm 角程度のホログラムであれば,1時間以下で描画が可能で ある.

また試作プリンタでは,レーザパルスのパワー変調によ り,濃度階調を有する画像の描画を可能にしている.この 時,LD 出力に対する描画像の透過率曲線を測定し,測定 した透過率曲線に基づいてLD 出力を制御することにより, 合成したホログラムの濃度階調とほぼ線形な透過率分布の 描画を可能とした.これにより,マルチレベルホログラム を描画し,その光学再生像を確認することができた.

本プリンタの試作・実験にご協力頂いた卒業生の近藤剛 司と星野哲也,大学院在学生の山中俊介,および CGH 作 成にご協力頂いた近藤暁靖の各氏に深謝致します.また, 本研究に有意義な議論と支援を頂いた関西大学高井正弘先 生に感謝致します.

- M. Lucente: "Interactive computation of holograms using a lookup table", J. Electronic Imaging, 2, pp. 28-34 (1993).
- 2) 岩瀬,吉川: "差分法に基づくフレネルホログラムの高速計算法",映情 学誌, 52, 6, pp. 899-901 (1998).
- 3) H. Yoshikawa, S. Iwase and T. Oneda: "Fast computation of Fresnel holograms employing difference", SPIE Proc. Practical Holography XIV and Holographic Materials VI, #3956, pp. 48– 55 (2000).
- 4) K. Matsushima and M. Takai: "Recurrence formulas for fast creation of synthetic three-dimensional holograms", Appl. Opt., 39, pp. 6587–6594 (2000).
- 5) 松島, H. Schimmel, F. Wyrowski: "波面展開法を用いた表面モデ ル CGH の高速計算法", 3 次元画像コンファレンス 2001, pp. 13–16 (2001).
- 6) K. Matsushima, H. Schimmel and F. Wyrowski: "New creation algorithm for digitally synthesized holograms in surface model by diffraction from tilted planes", SPIE Proc. Practical Holography XVI and Holographic Materials VIII, #4659, pp. 53–60 (2002).
- 7) A. J. Lee and D. P. Casasent: "Computer generated hologram recording using a laser printer", Appl. Opt., 26, pp. 136–138 (1987).
- 8) 梶木: "マルチ照明法による計算機合成パイナリホログラムの視域の拡大", 3次元画像コンファレンス'99, pp. 293-294 (1999).
- 9)山岸,吉川: "計算機合成ホログラムの広視域化",光学,27,pp. 535-538 (1998).
- 10) N. Yoshikawa, M. Itoh and T. Yatagai: "Binary computergenerated holograms for security applications from a synthetic double-exposure method by electron-beam lithography", Optics Lett., 23, pp. 1483–1485 (1998).
- 11) 松島, 本荘: "陰影付けした表面モデル3次元物体の全方向視差計算機 合成ホログラム", 映情学誌, 56, 6, pp. 986–992 (2002).

